(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-277740 (P2001-277740A)

				(4	3)公開	日平	成13年10	月10日(2001. 10. 10)	
(51) Int.Cl.7		識別配号	FΙ					テーマコート*(参考)		
B41N	1/14		B41	N 1/	/14			2	H025	
	3/03			3,	/03			2	H096	
		501					501	2	H114	
G03F	7/00	503	G 0 3	F 7	/00		503			
	7/004	505		7,	/004		505			
		審查	東京 未請求	請求項	の数3	OL	(全 29]	頁) j	最終頁に続く	
(21) 出願番号	j.	特顧2000-102463(P2000-102465	3) (71)出	職人	000005	201				
					富士写	真フイ	ルム株式会	社		
(22)出順日		平成12年4月4日(2000.4.4)		神奈川県南足柄市中沼210番地						
			(72)発	(72)発明者 前本 -						
(31) 優先権主	E張番号	特顧2000-18968 (P2000-18968)			静岡県	榛原郡	吉田町川原	₹4000₩	地 富士写	
(32) 優先日		平成12年1月27日(2000.1.27)		真フイルム株式会社内						
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(74) 4%	理人	100105	647				
				:	弁理士	小栗	昌平	(外4名	i)	
								1	最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 平版印刷版用原版

(57)【要約】

【課題】 熱により画像を形成し、良好な機上現像性を 示し、かつ、より多くの印刷物を得ることができる平版 印刷版用原版を提供する。

【解決手段】 親水性支持体上に、熱により合体する微 粒子状のボリマーを含有する感熱層を設けた平版印刷版 用原版であって、上記微粒子状のポリマー中に、他の微 粒子状のボリマー中に存在する官能基もしくは感熱層中 の他成分中に存在する官能基と反応しうる官能基を有す ることを特徴とし、該親水性支持体が粗面化処理を行な った後、陽極酸化処理を行なったアルミニウム基板であ ることが好ましく、該アルミニウム基板がさらにシリケ ート処理を行なったものであることが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 親水性支持体上に、画像形成に用いる熱 で外壁が破れ、かつその熱により反応する官能基を有す る化合物を含有しているマイクロカプセルからなる感熱 層を設け、光熱変換材料を感熱層かその隣接する層に含 有していることを特徴とする平版印刷版用原版。

【請求項2】 前記親水性支持体が粗面化処理を行なっ た後、陽極酸化処理を行なったアルミニウム基板である ことを特徴とする請求項1記載の平版印刷版用原版。

【請求項3】 前記アルミニウム基板がさらにシリケー 10 ト処理を行なったものであることを特徴とする請求項2 記載の平版印刷版用原版。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】本発明は親水性表面を有する 支持体、及び親水性の画像形成層からなるネガ型の平版 印刷版用原版に関する。より詳しくは、ディジタル信号 に基づいた走査露光による製版が可能であり、高感度日 つ高耐刷性で残色、汚れのない印刷物を与えることが可 能な平版印刷版用原版に関する。

[00002]

【従来の技術】一般に、平版印刷版は、印刷過程でイン クを受容する親油性の画像部と湿し水を受容する親水性 の非画像部とからなる。このような平版印刷版用原版と しては、従来、親水性支持体上に、親油性の感光性樹脂 層 (インク受容層) を設けたPS版が広く用いられ、そ の平版印刷版用原版からの平版印刷版の製版方法とし て、通常は、リスフイルムを介してマスク露光した後、 非画像部を現像液によって溶解除去することにより所望 の印刷版を得ていた。

【0003】近年、画像情報をコンピュータを用いて電 子的に処理、蓄積、出力する、ディジタル化技術が広く 普及してきており、この様な、ディジタル化技術に対応 した、新しい画像出力方式が種々実用される様になって きた。これに伴い、レーザ光の様な指向性の高い活性放 射線をディジタル化された画像情報に応じて走査し、リ スフィルムを介することなく、直接印刷版を製造するコ ンピュータ トゥ プレート (CTP) 技術が切望され ており、これに適応した印刷版用原版を得ることが重要 な技術課題となっている。

【0004】他方、従来のPS版に於ける製版行程は、 露光の後、非画像部を溶解除去する工程が不可欠であ り、この様な付加的な湿式の処理が不可欠であるという 点は、従来技術に対し、改善の望まれてきたもう一つの 課題である。特に近年は、地球環境への配慮が産業界全 体の大きな関心事となっている。処理の簡素化、乾式 化、無処理化は、この様な環境面と、先述のディジタル 化に伴った工程の合理化の両方の観点から、従来にも増 して、強く望まれるようになっている。

す方法の一つとして次のような方法が提案されている。 即ち、印刷版用原版の非画像部の除去を通常の印刷過程 のなかで行えるような感光層を用い、現像工程を行うこ となく、露光後、印刷機上で現像し最終的な印刷版を得 る方式である。この様な方法での平版印刷版の製版方式 は機上現像方式と呼ばれる。具体的方法としては、例え ば、湿し水やインク溶剤に可溶な感光層の使用、印刷機 中の圧胴やブランケット胴との接触による力学的除去を 行う方法等が挙げられる。しかしながら、従来のPS版 を機上現像方式の印刷版に応用する場合、原版は露光後 も、感光層が定着されないため、例えば、印刷機に装着 するまでの間、版を完全に遮光及び/もしくは恒温条件 にて保存しなければならないといった大きな問題点があ った。

【0006】上述のような技術課題に対し、走査露光に よる印刷版の製造法として、最近、半導体レーザ、YA Gレーザ等の固体レーザで高出力なものが安価に入手で きるようになってきたことから、特に、これらのレーザ を用いる方法が有望視されるようになってきた。これら 20 の高出力レーザを用いた高パワー密度露光系では、従来 の低~中パワー密度露光用感光材料系に利用される光反 応とは異なった、様々な現象を利用できる。具体的に は、化学変化の他、相変化、形態変化、等の構造変化を 利用できる。通常、このような高パワー密度露光による 記録方式はヒートモード記録と呼ばれる。高パワー密度 露光系では、多くの場合、感材に吸収された光エネルギ 一は、熱に変換され、生じた熱によって、所望の現象が 引き起こされると信じられる為である。

【0007】この様なヒートモード記録方式の大きな長 30 所は露光後の像の定着が必須ではないことにある。即 ち、ヒートモード感材の画像記録に利用される現象は、 普通の強度の光に対する暴露や、普通の環境温度下では 実質的に生じないため、露光後の画像の定着は必須では ない。従って、例えば、ヒートモード露光により不溶化 若しくは可溶化する感光層を用い、画像露光後、任意の 時間、たとえ環境光に暴露させてから現像(非画像部の 除去)を行っても得られる画像に変化が生じないシステ ムが可能である。従って、ヒートモード記録によれば、 先述の機上現像方式に望ましい平版印刷版用原版を得る 40 ことも可能となる。

【0008】ヒートモード記録に基づく平版印刷版の好 ましい製造法の一つとして、親水性の支持体上に親水性 の画像形成層を設け、画像状にヒートモード露光し、親 水性層の溶解性・分散性を変化させ、必要に応じ、湿式 現像により未露光部を除去する方法が提案されている。 また、従来のヒートモード方式原版には、非画像部の汚 れ性が悪い。若しくは画像部の強度が弱いという別の大 きな問題があった。即ち、画像形成層中の支持体近傍で の露光による溶解性変化が、画像形成層表面近傍に比較 【0005】この様な観点から、従来の処理工程をなく 50 して小さいという点の改良が必要であった。該ヒートモ ード方式原版においては、ヒートモード露光時の熱の発 生は記録層中の光吸収剤の光吸収に基くものであるた め、熱の発生量は記録層表面で大きく、支持体近傍では 小さいため、支持体近傍での記録層の溶解性変化の程度 が比較的小さくなってしまうものである。結果としてし ばしば、ヒートモードネガ型原版においては、本来疎水 性のインク受容層を提供すべき露光部において、インク 受容性層が現像及び/又は印刷工程中に除去されること があった。この様な、ネガ型原版における画像部インク 受容性層の除去は、印刷性能上耐刷性が悪いという問題 10 を生じる。特に、印刷適性上好ましい、Alのような熱 伝導性の高い金属支持体を用いた場合、熱拡散によっ て、一層、支持体近傍での温度上昇が妨げられるため、 上述のような問題は顕著である。基板付近の十分な溶解 性変化を得るためには、極端に大きな露光エネルギーを 要するか、若しくは露光後の加熱といった後処理を実施 する必要があった。

3

【0009】例えば、特許2938397号公報に記載されているように、熱可塑性症水性重合体微粒子を赤外線レーザー露光により熱無着させ画像形成させた上で、20印刷機シリンダー上に版を取付け、湿し水および/あるいはインクにより機上現像する方法がある。しかしながらこのように単に熟融着で画像を作る方法では、良好な様上現像性を示すものの、アルミコウム基板にはり奪われるために基板・感熱傷界面上で反応が起こちず、耐削性が不十分となってしまう。同様に特開平9-127683号公報のも30世代を10186号公報にも熱可塑性微粒子を執疑者し機上現像により画像形成することが記載されているが、耐削性が不十分となっ30

[0011]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、機上現像性が良好であり、感度が高く、かつ高顔剛性を示す感動性の感性ないまだ得られていない。そこで本発明は熱により画像を形成する印刷機上現像可能な平版印刷版用原版において、良好な機上現像性を示し、かつ、より多くの印刷物を得るようにすることを目的とするものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、親水性支持体 上に、画像形成に用いる熱で外壁が傾れ、かつその熱に より反応する首能基を有する化合物を含有しているマイ クロカプセルからなる感熱層を設け、光熱変換鉄料を感 熱層かその隣接する層に含有していることにより、機上 現像性が良好でありながら、かつ高耐刷である。目明機 上で現像可能な平版印刷版用原版を与えるものである。 【0013】

0 【発明の実施の形態】以下本発明について詳細に説明する。

「マイクロカブセル)本発明に使用されるマイクロカブ セルは、画像形成に用いる熱で外壁が破れ、かつその熱 により反応する音能基(熱反応性基ともいう)を有する 化合物を含有しており、その中地粒径は0.01μm~ 20μmが好ましいが、その中でも0.05μm~2.0 μmが現に好ましく、特に0.10μm~1.0μmが 弱道である。平均粒径が大き過ぎると解像皮が悪く、ま た小さ過ぎると解検定が無く、たってしまう。

【0014】 これらのマイクロカプセルは、その中に含

有される上記化合物の熱反応性基を介してマイクロカプ

セル同士で反応できる構造としても良いし、聚熱層内に 他の添加物として後述の規水性機関または低分子化合物 を含有する場合にはそれらと反応できる構造としても良 い。また2種類以上のマイクロカブセルに、互いに熱反 方するような熱反反性基をそれぞれ持たせてマイクロカ プセル同士を反応させることのできる構造としても良 い。すなわち、これらの熱反応性基による反応として は、不飽和基による重合反応、イソシアナート基あるい はそれのブロック体と活性水素原子を有する化合物(例 えばアミン、アルコール、カルボン酸など)による付加 反応、エポキシ基とアミノ基・カルボキシル基とドロ キシル基との付加反応、カルボキンル基とドロ キシル基との付加反応、カルボキンル基とドロ キョンは、オール・フェノメトの総合反応、静無水物とアミノ基 をあるいはアミノ基との総合反応、静無水物とアミノメ 基本るいはアミノ基との総合反応、静無水物とアミノメ

あるいはヒドロキシル基との開環付加反応などを挙げる

ことができ、これらは化学結合が形成されればどのよう

な反応でもよい。

- 【0015】このような熱反応性基を有する化合物を含有するマイクロカブセルは、例えば、アクリレート基、メタクリレート基、ピニル基、アリル基、エポキシ基、アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、インシア・ペート、 能無状物もおびそれらを保護した基等の熱反応性基を有する化合物(後に詳述する)をマイクロカブセルに内包させるか、これらの化合物をマイクロカブセルの外壁に導入する方法により得ることができる。また、熱反応性基を有する化合物をマイクロカブセルに内包させると同時に、マイクロカブセルの外壁に該化合物を導入しても見か、
- 【0016】マイクロカプセルに含有される熱反応性基 50 を有する化合物としては、不飽和基を有する化合物が挙

げられ、不飽和基を有する化合物は、少なくとも一個の エチレン性不飽和二重結合を有するラジカル重合性化合 物であり、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1 個、好ましくは2個以上有する化合物から選ばれる。こ の様な化合物群は当該産業分野において広く知られるも のであり、本発明においてはこれらを特に限定無く用い る事ができる。これらは、例えばモノマー、プレポリマ 一、すなわち2量体、3量体およびオリゴマー、または それらの混合物ならびにそれらの共重合体などの化学的 形態をもつ。モノマーおよびその共重合体の例として は、不飽和カルボン酸(例えば、アクリル酸、メタクリ ル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレ イン酸など)や、そのエステル類、アミド類が挙げら れ、好ましくは、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコ 一ル化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪旋名 価アミン化合物とのアミド類が用いられる。また、ヒド ロキシル基や、アミノ基、メルカプト基等の求核性置換 基を有する不飽和カルボン酸エステル、アミド類と単官 能もしくは多官能イソシアネート類、エポキシ類との付 加反応物、単官能もしくは、多官能のカルボン酸との脱 20 水縮合反応物等も好適に使用される。また、イソシアナ ート基やエポキシ基等の親電子性置換基を有する不飽和 カルボン酸エステルまたはアミド類と、単官能もしくは 多官能のアルコール類、アミン類およびチオール類との 付加反応物、さらに、ハロゲン基やトシルオキシ基等の 脱離性置換基を有する不飽和カルボン酸エステルまたは アミド類と、単官能もしくは多官能のアルコール類、ア ミン類およびチオール類との置換反応物も好適である。 また、別の例として、上記の不飽和カルボン酸の代わり に、不飽和ホスホン酸、スチレン等に置き換えた化合物 30 群を使用する事も可能である。

【0017】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カル ボン酸とのエステルであるラジカル重合性化合物の具体 例としては、アクリル酸エステルとして、エチレングリ コールジアクリレート、トリエチレングリコールジアク リレート、1、3-ブタンジオールジアクリレート、テ トラメチレングリコールジアクリレート、プロピレング リコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジア クリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー ト、トリメチロールプロパントリ(アクリロイルオキシ プロピル) エーテル、トリメチロールエタントリアクリ レート、ヘキサンジオールジアクリレート、1、4-シ クロヘキサンジオールジアクリレート、テトラエチレン グリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジア クリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート。 ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエ リスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトール ヘキサアクリレート、ソルビトールトリアクリレート、 ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールペンタ アクリレート、ソルゼトールヘキサアクリレート、トリ 50 ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレ

(アクリロイルオキシエチル) イソシアヌレート、ポリ エステルアクリレートオリゴマー等がある。

【0018】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ レングリコールジメタクリレート、1.3-ブタンジオ ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ 10 ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート。 ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク リレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビト ールテトラメタクリレート、ビス [p-(3-メタクリ ルオキシー2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル)ジメ チルメタン、ビスー [n-(メタクリルオキシエトキ シ) フェニル] ジメチルメタン等がある。 【0019】 イタコン酸エステルとしては、エチレング

リコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタ コネート、1、3 ープタンジオールジイタコネート、 1. 4 - ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレ ングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジ イタコネート、ソルビトールテトライタコネート等があ

【0020】 クロトン酸エステルとしては、エチレング リコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジ クロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、 ソルビトールテトラジクロトネート等がある。

【0021】イソクロトン酸エステルとしては、エチレ ングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトー ルジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロト ネート等がある。

【0022】マレイン酸エステルとしては、エチレング リコールジマレート、トリエチレングリコールジマレー ト、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテ トラマレート等がある。

【0023】その他のエステルの例として、例えば、特 公昭46-27926、特公昭51-47334、特開 40 昭57-196231記載の脂肪族アルコール系エステ ル類や、特開昭59-5240、特開昭59-524 1、特開平2-226149号記載の芳香族系骨格を有 するもの、特開平1-165613号記載のアミノ基を 含有するもの等も好適に用いられる。

【0024】また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和力 ルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチ レンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリル アミド、1、6ーヘキサメチレンピスーアクリルアミ ド. 1. 6 ーヘキサメチレンビスーメタクリルアミド、

ンピスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリルアミ ド等がある。

【0025】その他の好ましいアミド系モノマーの例と しては、特公昭54-21726号公報記載のシクロへ キシレン構造を有すものを挙げることができる。

【0026】また、イソシアネートと水酸基の付加反応 を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適 であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭 4 8-41708号公報中に記載されている1分子に2個 以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化 10 合物に、下記式 (A) で示される水酸基を含有するビニ ルモノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合性ビ ニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられ

【0027】一般式(A)

 $CH_2 = C (R_{41}) COOCH_2 CH (R_{42}) OH$ (ただし、Rn およびRoは、HまたはCHsを示 す。)

【0028】また、特開昭51-37193号、特公平 2-32293号、特公平2-16765号に記載され 20 ているようなウレタンアクリレート類や、特公昭58-49860号、特公昭56-17654号、特公昭62 -39417、特公昭62-39418号記載のエチレ ンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適で ある。

【0029】さらに、特開昭63-277653号、特 開昭63-260909号、特開平1-105238号 に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を 有するラジカル重合性化合物類を用いても良い。

【0030】その他の例としては、特開昭48-641 83号、特公昭49-43191号、特公昭52-30 490号、各公報に記載されているようなポリエステル アクリレート類、エポキシ樹脂と (メタ) アクリル酸を 反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリ レートやメタクリレートを挙げることができる。また、 特公昭46-43946号、特公平1-40337号、 特公平1-40336号記載の特定の不飽和化合物や、 特開平2-25493号記載のビニルホスホン酸系化合 物等も挙げることができる。また、ある場合には、特開 昭61-22048号記載のペルフルオロアルキル基を 40 を得ることができる。 含有する構造が好適に使用される。さらに日本接着協会 誌 vol. 20、No. 7、300~308ページ(198 4年) に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介 されているものも使用することができる。

【0031】エポキシ化合物としては、このましくはグ リセリンポリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコ ールジグリシジルエーテル、ポリプロピレンジグリシジ ルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシジルエ ーテル、ソルピトールポリゲリシジルエーテル、ビスフ 水麦添加物のポリグリシジルエーテル体などが挙げられ る。イソシアネートを有する化合物としては、好ましく はトリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソ シアネート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネ ート、キシリレンジイソシアネート、ナフタレンジイソ シアネート、シクロヘキサンフェニレンジイソシアネー ト、イソホロンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイ ソシアネート、シクロヘキシルジイソシアネート、ある いはそれらをアルコールあるいはアミン類でブロックし た化合物を挙げることができる。アミン化合物として は、好ましくはエチレンジアミン、ジエチレントリアミ ン、トリエチレンテトラミン、ヘキサメチレンジアミ ン、プロピレンジアミン、ポリエチレンイミンなどが挙 げられる。

【0032】ヒドロキシル基を有する化合物としては好 ましくは、末端メチロールを有するような化合物、ペン タエリスリトールなどの多価アルコール、ビスフェノー ル・ポリフェノール類などを挙げることができる。カル ボキシル基を有する化合物としては好ましくは、ピロメ リット酸、トリメリット酸、フタル酸などの芳香族多価 カルボン酸、アジピン酸などの脂肪族多価カルボン酸な どが挙げられる。酸無水物としては好ましくは、ピロメ リット酸無水物、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水 物などが挙げられる。

【0033】以上具体的に詳述した熱反応性基を有する 化合物が含有されたマイクロカプセルを本発明の平版印 刷版用原版の感熱層に含有させることにより、該マイク ロカプセルの外壁が画像形成時の熱により破れ、該マイ クロカプセルに含有させる該化合物が感熱層中に放出さ 30 れると共に化学反応を起こし、これにより感熱層の画像 部の分子構造は三次元架橋体に変化する。よって、画像 形成前後において、画像部の水又は水溶液に対する溶解 性の差は大きいものとなり、良好な機上現像性を示す。 また、マイクロカプセルとしては画像形成に用いる熱で 外壁が破れるものを使用しているため、前記化合物がマ イクロカプセル外の化合物と確実に熱反応できるので、 前記三次元架橋体の架橋密度は非常に高いものであると 考えられる。よって、画像形成後において、高い強度を 有する画像部が得られると考えられ、 より多くの印刷物

【0034】本発明に用いられる好ましいマイクロカプ セルの壁材は、ポリウレア、ポリウレタン、ポリエステ ル、ポリカーボネート、ポリアミド、およびこれらの混 合物が好ましく、特に、ポリウレアおよびポリウレタン が好ましい。マイクロカプセルの外壁には、前記したよ うに、熱反応性基を有する化合物を導入しても良い。 【0035】熱反応性基を有する化合物を含有物として マイクロカプセル化する方法としては、公知のマイクロ カプセル化法が適用できる。例えばマイクロカプセルの ェノール類あるいはポリフェノール類もしくはそれらの 50 製造方法としては、米国特許2800457号、同28

00458号明細書に見られるコアセルベーションを利 用した方法、英国特許990443号、米国特許328 7 1 5 4号明細書, 特公昭3 8 - 1 9 5 7 4号, 同 4 2 446号、同42-711号に見られる界面重合法に よる方法、米国特許3418250号、同366030 4号明細書に見られるポリマーの析出による方法、米国 特許3796669号明細書に見られるイソシアネート ポリオール壁材料を用いる方法、米国特許391451 1号明細書に見られるイソシアネート壁材料を用いる方 法、米国特許4001140号、同4087376号、 問4089802号明細書に見られる尿素―ホルムアル デヒド系あるいは尿素ホルムアルデヒドーレゾルシノー ル系壁形成材料を用いる方法、米国特許4025445 号にみられるメラミンーホルムアルデヒド樹脂、ヒドロ

キシセルロース等の壁材を用いる方法、特公昭36-9

163号、同51-9079号に見られるモノマー重合

によるin situ法、英国特許930422号、米

国特許3111407号にみられるスプレードライング

法、英国特許952807号、同967074号にみら

れる電解分散冷却法などがあるが、これらに限定される 20

9

ものではない。 【0036】 [光熱変換材料] また本発明の平版印刷版 用原版は、その感熱層内またはそれに隣接する層内に光 熱変換材料を含有していることにより、レーザー光照射 等により画像書き込みを行うことができる。さらに、光 熱変換材料から発生される熱を有効に利用するために、 光熱変換材料をマイクロカプセル内に含有させることが 好ましい。光熱変換材料をマイクロカプセル内に含有す ることでマイクロカプセルの外壁破壊、内包物質の放 出、反応物質の反応活性化に対し、有効に熱を利用でき 30 る。これにより、本発明の平版印刷版用原版の耐刷性が 向上できる。その光熱変換材料としては、カーボンプラ ック・金属微粒子および色素など光源の波長を吸収する ものであれば特に限定されないが特に赤外線を吸収し熱 に変換する化合物が好ましい。

【0037】光熱変換材料は700nm以上の光を吸収 する物質が特に好ましく、種々の顔料や染料を用いる事 ができる。顔料としては、市販の顔料およびカラーイン デックス (C. [.) 便覧、「最新顔料便覧」(日本顔 料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」 (CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」C MC出版、1984年刊) に記載されている顔料が利用 できる。

【0038】顔料の種類としては、黒色顔料、褐色顔 料、赤色顏料、紫色顏料、青色顏料、緑色顏料、蛍光顏 料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられ る。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮 合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔 料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系 キサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロ ン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔 料, 二十口頗料, 天然顏料, 蛍光顏料, 無機顏料, 力一 ボンブラック等が使用できる。

【0039】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよ く、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法に は親水性樹脂や親油性樹脂を表面コートする方法、界面 活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シリカ ゾル、アルミナゾル、シランカップリング剤やエポキシ 化合物、イソシアネート化合物等)を顔料表面に結合さ せる方法等が考えられる。 上記の表面処理方法は、「金 属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」 (CMC出版、1984年刊) および「最新顔料応用技 術」(CMC出版、1986年刊) に記載されている。 これらの顔料中、赤外光又は近赤外光を吸収するもの が、赤外光又は近赤外光を発光するレーザでの利用に適 する点で特に好ましい。

【0040】そのような赤外光又は近赤外光を吸収する 顔料としてはカーボンブラック、親水性樹脂でコートさ れたカーボンプラックやシリカゾルで変性されたカーボ ンプラックが好適に用いられる。これらの中でも特に水 溶性の樹脂と分散し易く、かつ親水性を掴わないものと して、親水性樹脂やシリカゾルで表面がコートされたカ ーポンプラックが有用である。

【0041】顔料の粒径は0.01 μm~1 μmの範囲

にあることが好ましく、 $0.01\mu m \sim 0.5\mu m$ の節 囲にあることが更に好ましい。顔料を分散する方法とし ては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分 散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、 サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミ ル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、 KDミ ル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加 圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技 術」(CMC出版、1986年刊) に記載がある。

【0042】染料としては、市販の染料および文献(例) えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年 刊) に記載されている公知のものが利用できる。具体的 には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染 料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボ 40 ニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン 染料などの染料が挙げられる。これらの染料中、赤外 光、もしくは近赤外光を吸収するものが、赤外光もしく は近赤外光を発光するレーザでの利用に適する点で特に 好ましい。

【0043】赤外光又は近赤外光を吸収する染料として は、例えば特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭60-78787号、米国特許 4.973,572号明細書、特開平10-26851 2号等に記載されているシアニン染料、特開昭58-1 顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオ 50 73696号、特開昭58-181690号、特開昭5 8-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭58-224793号、特開昭60-48187号、特開昭60-63744号等に記載されているよフトキン染料、特開昭60-52940号、特別昭60-63744号等に記載されているよフトキン染料、特開昭58-112792号等に記載されているスクワリリウム染料、英国特殊者434、875号記載のシアニン染料や

11

染料、英国特許 4 3 4, 8 7 5 号記載のシアニン染料や 米国特許第 4, 7 5 6, 9 9 3 号明細書記載の染料、米 国特許第 4, 9 7 3, 5 7 2 号明細書に記載のシアニン 染料および特開平 1 0 - 2 6 8 5 1 2 号記載の染料を挙 10 行ることができる。

[0044]

$$Z^{1} \xrightarrow{R^{2}} R^{3} \xrightarrow{R^{6}} Z^{2}(X)_{n-1}$$
 (1)

【0045] 「式中、R¹、R²、R²、R³、R⁴、R³及びR⁶ は、置換又は未置換のフェル基又はナフタレン巻: しは置換又は未置換のメチン基で、該置換基は、炭素数8以下のアルキル基、ハロゲン原子又はアミノ基であるか、該メーン基がその2つのメチン炭素上の置換基が相互に結合して形成された置換基を有していても良いシクロペキセン環またはシウロペンテン環を含むものであってもよく、該置機基は炭素数6以下のアルキル基またはハロゲン原子: Xは2アニオン基: nは1又は2:そしてR²、R²、R²、R²、R²、R²、R²、2²及び2²の少なくとも一つは酸性基又は酸性基のアルカリ金属塩基又はアミン塩基を含まる密度は表示す。

[0046]

【化2】

【0047】【式中、R"は置換のトジは未鑑機のアルキル基、置換もしくは未置機のアリール基以高置換も はは未置換のテロ環基:R"及びR"は水素原子又は 水素原子の代りに置換できる基:R"及びR"は水素原子 天、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルコキシ基 、は間時に未素原子ではない:R"及びR"は高機もしくは未置換のアルキル基、信用に なは、は大量機のアルキル基、とは未置換のアリール基、アはR"とR"で非 を属5負費をしくはも負債の形成を示す。

【0048】また、染料として米国特許第5,156. 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、ま た、米国特許第3.881.924号記載の置換された アリールベンゾ (チオ) ピリリウム塩、特開昭57-1 42645号(米国特許第4, 327, 169号) 記載 のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-1810 51号、同58-220143号、同59-41363 号、同59-84248号、同59-84249号、同 59-146063号、同59-146061号に記載 されているピリリウム系化合物、特開昭59-2161 4.6号記載のシアニン染料、米国特許第4.283.4 7.5号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公 平5-13514号、同5-19702号公報に開示さ れているピリリウム化合物、エポリン社製EDolig ht III-178, Epolight III-130, Epolight III-125等は特に好ましく用い られる。これらの染料中、マイクロカプセル内に内包さ せる場合は、合成上の観点から、水と混合しない溶剤に 溶解可能なものが好ましい。酢酸エチルに溶解できるも 30 のがさらに好ましい。具体的には炭素数 4 以上のアルキ ル鎖を含む油溶性シアニン、油溶性フタロシアニン、油 溶性ポリメチン色素等が挙げられる。マイクロカプセル 外に添加する場合、特に好ましいものは上記の式(1) の水溶性のシアニン染料である。下記に具体的な化合物 を列記する。

[0049]

【化3】

40

$$(I-2) \\ CH_3 \\ CH_4 \\ CH_5 \\$$

[0050] 30 [化4]

$$(I-6) \\ HO \\ CH_3 \\ CH_4 \\ CH_5 \\ C$$

$$(I-7) \\ \text{KO}_{3}S \\ \begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{SO}_{3}^{*} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{SO}_{3}^{*} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} \\$$

$$(1-8) \\ \text{CH}_3 \text{NHCONH} \\ \text{CH}_3 \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \text{CH} \\ \text{CH}_2 \text{CH} \\ \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ \text{SO}_3^{\text{R}} \\ \text{SO}_3^{\text{R}} \\ \text{SO}_3^{\text{R}} \\ \text{CH}_3 \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \text{CH}_3 \\ \text$$

[(0051]

$$\begin{array}{c} 17 \\ \text{(I-9)} \\ \text{KO}_3\text{S} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{N} \\ \text{CH+} \text{CH-} \text{CH} \\ \text{SO}_3^e \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{J}_3 \\ \text{SO}_3^e \\ \text{SO}_3^K \\ \end{array}$$

$$(I-11) \\ KO_3S \\ CH_6 \\ CH_2 \\ CH_2 \\ CH_3 \\ CH_3$$

$$(I-12) \\ NaO_3S \\ C_2H_5 \\ C_3N_3 \\ C$$

[0052] [任6]

$$(1-14) \\ \text{KO}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}$$

[0053] 30 [作7]

$$(I-18) \\ NaC_9SC+_2SC_2 \\ CH_9 \\ CH_9 \\ CH_9CH-CH_3 \\ CH_9C_1 \\ CH_92 \\ SO_8^6 \\ SO_9K$$

[0054] 【化8】

[0055] [化9]

[0056]

.

【0058】次に、光熱変換性の金属微粒子について述 べる。金属粒子の多くは、光熱変換性であってかつ自己 発熱性でもある。好ましい金属微粒子として、Si、A 1, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Mo, Ag, Au, Pt, Pd, R h, In, Sn, W, Te, Pb, Ge, Re, SbO 単体又は合金あるいはそれらの酸化物、硫化物の微粒子

でも好ましい金属は、光照射によって熱融着し易い融点 がおよそ1000℃以下で赤外、可視又は紫外線領域に 吸収をもつ金属、たとえばRe、Sb、Te、Au、A g、Cu、Ge、Pb及びSnである。また、とくに好 ましいのは、融点も比較的低く、熱線に対する吸光度も 比較的高い金属の微粒子、たとえばAg、Au、Cu、 Sb、Ge及びPbで、とくに好ましい元素はAg、A u及びCuが挙げられる。

【0059】また、例えばRe、Sb、Te、Au、A 40 g、Cu、Ge、Pb、Snなどの低融点金属の微粒子 とTi、Cr、Fe、Co、Ni、W、Geなどの自己 発熱性金属の微粒子を混合使用するなど、2種以上の光 熱変換物質で構成されていてもよい。また、Ag、P 1、Pdなど微小片としたときに光吸収がとくに大きい 金属種の微小片と他の金属微小片を組み合わせて用いる ことは好ましい。以上に述べた金属単体及び合金の微粒 子は、表面を親水性化処理することによって、本発明の 効果がより発揮される。表面親水性化の手段は、親水性 でかつ粒子への吸着性を有する化合物、例えば界面活性 が挙げられる。これらの金属微粒子を構成する金属の中 50 剤で表面処理したり、粒子の構成物質と反応する親水性

基を持つ物質で表面処理したり、保護コロイド性の親状 性高分子投膜を設けるなどの方法を用いることができ る。特に穿ましいのは、表面シリケート処理であり、例 えば鉄微粒子の場合は、70℃のケイ酸ナトリウム (3 %) 水溶液に30秒浸漬する方法によって表面を十分に 親水性化することができる。他の金属微粒子も同様の方 法で表面シリケート処理を行うことができる。

 $[0\,0\,6\,0]$ これらの起子の粒径は、 $1\,0\,\mu$ m以下、好 ましくは、 $0.0\,0\,3$ ~5 μ m、さらに好ましくは、 $0.0\,1$ ~3 μ m である。 億小であるほど、熟練着温度 は低下する、つまりヒートモードの光度度が高くなって け都合であるが、粒子の分散が難しく、 $1\,0\,\mu$ m以上では、日刷物の解像度が悪くなる。本発明において、これらの光度変換材料を用いる場合、その添加層は、悠熱層の全国形分中、1 重量公上とするり、好ましくほ 2 重量%以上、神に好ましくは 5 重量%以上で用いられる。 光熱変換材料の含有量が 1 重量% 以上で用いられる。 光熱変換材料の含有量が 1 重量% 以上で用いられる。 光熱変換材料の含有量が 1 重量% よ流であると態度が低くなってしまう。

【0061】〔親水性樹脂〕本発明の平版印刷版用原版 の感熱層中には親水性樹脂を添加しても良い。親水性樹 20 脂を添加することで機上現像性が良好となるばかりか、 感熱層自体の皮膜強度も上がる。親水性樹脂としては3 次元架橋していないものが機上現像性が良好で好まし い。親水性樹脂としては、例えばヒドロキシル、カルボ キシル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル、アミ ノ、アミノエチル、アミノプロピル、カルボキシメチル などの親水基を有するものが好ましい。具体的な親水性 樹脂として、アラビアゴム、カゼイン、ゼラチン、澱粉 誘導体、カルボキシメチルセルロース及びそれらのNa 塩、セルロースアセテート、アルギン酸ナトリウム、酢 30 酸ビニルーマレイン酸コポリマー類、スチレンーマレイ ン酸コポリマー類。ポリアクリル酸類及びそれらの塩、 ポリメタクリル酸類及びそれらの塩、ヒドロキシエチル メタクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロ キシエチルアクリレートのホモボリマー及びコボリマ ヒドロキシプロピルメタクリレートのホモポリマー 及びコポリマー、ヒドロキシプロピルアクリレートのホ モポリマー及びコポリマー、ヒドロキシブチルメタクリ レートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシブチ ルアクリレートのホモポリマー及びコポリマー、ポリエ 40 チレングリコール類、ヒドロキシプロピレンポリマー 類、ボリビニルアルコール類、ならびに加水分解度が少 なくとも60重量%、好ましくは少なくとも80重量% の加水分解ポリビニルアセテート、ポリビニルホルマー ル、ポリビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、ア クリルアミドのホモポリマー及びコポリマー、メタクリ ルアミドのホモポリマー及びポリマー、N-メチロール アクリルアミドのホモポリマー及びコポリマー、2-ア クリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸及びその

る。

【0062】 駅水性樹脂の感熱層中への添加量は、2% ~40%が好ましく、3%~30%がさらに好ましい。 2%より少ないと、皮膜強度が弱く、40%より多いと 機上現像性は良くなるものの耐削性が悪くなってしま う。

【0063】【反応を開始あるいは促進する化合物】 表明の平阪印刷版用原版の感熱層には、上記の熱反応性 基を有する化合物を含有するマイクロカプセルを用いるので、必要に応じてこれらの反応を開始あるいは促進するような化合物を添加してもよい。たとえば熱によりラジカルあるいはオイン・ス学イマー、トリハロメチル化合物、過酸化物、アゾ化合物、ジアゾニウム塩あるいはジフェニルヨードニウム塩などを含んだオーウム塩、アシルホスフィン、イミドスルホナートなどが挙げられる。これらの化合物は添加することができる。好ましくは20重量%~20重量%~10重量%の範囲で添加することができる。好ましくは20重量%~10重量%の範囲である。これより多いと機上環像性が更くなり、これより多いとと機上環像性が更くなり配利性が劣化する。

【0064】また、反応を効率よく進めるために、反応 を開始あるいは促進する化合物をマイクロカブセル内に 含有させることが好ましい。これらの化合物をマイクロ カブセル内に含有させることで、熱反広性基を有する化 合物とあらかじめ良く混ざり合った状態にすることがで き、レーザー照射すると、内包物が放出しながら反応が 可能となる。これにより、本発明の平版印削版用原版の 耐刷性がさらに向上できる。

【0065】【マイクロカプセルに含有される熱反応性 基を有する化合物と反応する低分子化合物、本発明の平 版印刷版用原版の感熱層には、さらに、画像形成に用い る旅で上記マイクロカプセルに合有される熱反応性基を 有する化合物と反応することができる官能基本よびその 保護基を有する低分子化合物を含有することができる。 これらの化合物の添加量は、燃熱層中5 重量%~4 0 重 量%が好ましく、特に5 重量%~2 0 重量%が好まし い、これより少ないと実施的果外かなく 試開地バホー分 となり、これより多いと経時後の機上現像性が悪くなっ てしまう。このような化合物の具体例としては、前記マ イクロカプセルと含有される形反び性基を有する化合物 の具体例と同様のものを挙げることができる。

なくとも60重量%、好ましくは少なくとも80重量%の加水分解が10 本発明では、さらに必要に加水でプレニルアセテート、ポリビニルオルマール、ポリピニルオリマー、メタクリルアミドのホモポリマー及びポリマー、メタクリルアミドのホモポリマー及びポリマー、メタクリカリルアミドのホモポリマー及びポリマー、スーアクリルアミドのホモポリマー及びプリマー、スーアクリルアミドのホモポリマー及びプリマー、スーアクリルアミドのエースがアプリルプロパンスルホン酸及びそのないまポリマー及びプリマー等を挙げることができ 50 イルブラックB、メイルがフックとB、オイルブリーンBC、オイルブカックBY、オルのホモポリマー及びコポリマー等を挙げることができ 50 イルブラックB、オイルブラックアー505 (以上オ

31

リエント化学工業(株)製)、ピクトリアピュアブル ー、クリスタルバイオレット (C 1 4 2 5 5 5)、メチ ルバイオレット (C 1 4 2 5 5 5)、エチルバイオレット ト、ローダミンB (C 1 1 4 5 1 7 0 B)、マラカイト グリーン (C 1 4 2 0 0 0 0)、メチレンブルー(C 1 5 2 0 1 5)等、及び特開紹ラ 2 - 2 9 3 2 4 7 号に記載 されている炭料を挙げることができる。また、フタロシ アニン系証料、アゾ系証料、カーボンブラック、酸化チ マンなどの間様も好強に用いることができる。

【0067】これらの着色剤は、画像形成後、画像部と 10 非画像部の区別がつきやすいので、添加する方が好まし い。なお、添加量は、感熱層塗布液全固形分に対し、 0.01~10重量%の割合である。

【0068】また、本発明においては、感熱層塗布液の 調製中あるいは保存中においてラジカル重合可能なエチ レン性不飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を 阳止するために少量の熱重合防止剤を添加することが望 ましい。適当な熱重合防止剤としてはハイドロキノン、 p-メトキシフェノール、ジーtーブチルーp-クレゾ ール、ピロガロール、tープチルカテコール、ベンゾキ 20 ノン、4、4′ーチオビス(3ーメチルー6ーtープチ ルフェノール)、2,2'-メチレンビス(4-メチル -6-t-ブチルフェノール)、N-ニトロソーN-フ ェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩等が挙げられ る。熱重合防止剤の添加量は、全組成物の重量に対して 約0.01重量%~約5重量%が好ましい。また必要に 応じて、酸素による重合阻害を防止するためにベヘン酸 やベヘン酸アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加し て、塗布後の乾燥の過程で感熱層の表面に偏在させても よい。高級脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物の約0. 1 重量%~約10重量%が好ましい。

【0069】また、本発明における感熱層塗布液中に は、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開 昭62-251740号や特開平3-208514号に 記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭59 -121044号、特開平4-13149号に記載され ているような両性界面活性剤を添加することができる。 非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリ ステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタ ントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオ 40 キシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。 【0070】両性界面活性剤の具体例としては、アルキ ルジ (アミノエチル) グリシン、アルキルポリアミノエ チルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエ チルーN-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイ ン、N-テトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、 商品名アモーゲンK、第一工業(株)製)等が挙げられ る。上記非イオン界面活性剤及び両性界面活性剤の感熱 層途布液中に占める割合は、0.05~15重量%が好 ましく、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0071】さらに、本発明に係る感熱層塗布液中には、必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑 別が加えられる。例えば、ボリエチレングリコール、ク エン酸トリプチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジプチル、フタル酸ジへキシル、フタル酸ジスキシル、リン酸トリカケチル、リン酸トリカレジル、リン酸トリカクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル等が用いられる。

【0072】本発明の平版印刷版用原版を製造するに

は、通常、感熱層塗布液に必要な上記各成分を溶媒に溶 かして、適当な支持体上に塗布すればよい。ここで使用 する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキ サノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノー ル. プロパノール. エチレングリコールモノメチルエー テル、1-メトキシー2-プロパノール、2-メトキシ エチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテ ート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、 N. Nージメチルアセトアミド、N. Nージメチルホル ムアミド、テトラメチルウレア、N-メチルピロリド ン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、 v ープチルラ クトン、トルエン、水等を挙げることができるがこれに 限定されるものではない。これらの溶媒は単独又は混合 して使用される。溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固 形分)の濃度は、好ましくは1~50重量%である。 【0073】また塗布、乾燥後に得られる支持体上の感 執層途布量 (固形分) は、用途によって異なるが、平版 印刷版用原版についていえば一般的に $0.5 \sim 5.0g$ /m'が好ましい。塗布する方法としては、種々の方法 を用いることができるが、例えば、バーコーター塗布、 回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗 布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を 挙げることができる。途布量が少なくなるにつれて、見 かけの感度は大になるが、画像記録の機能を果たす感熱 層の皮膜特性は低下する。

【0074】 本発明に係る感熱層盤が凝には、整合性を 良化するための界面活性剤、例えば、特開昭62-17 0950号に記載されているようなフッ素系界面活性剤 を添加することができる。好ましい添加量は、全感熱層 の料料部形分中0.01~1重量か、さらに好ましくは 0.05~0.5 電響がである。

【0075】(オーバーコート層)本発明の平版印刷版 用原版は、報油性物質による感熱層表面の汚染防止のた め、感熱層上に、水宿性オーバーコート層を設けること ができる。本発明に使用される水溶性オーバーコート層 は印刷時等場に除去できるものであり、水溶性の有機高 分子化合物から選ばれた樹脂を含有する。ここで用いる 水溶性の有機高分子化合物としては、途布症候によって できた機関がフォルム形成能を有するもので、具体的に は、ボリ酢酸ビニル(但し加水分解率65%以上のも 50の)、ポリアクリル酸およびそのアルカリ金属電あるの 50の)、ポリアクリル酸およびそのアルカリ金属電ある はアミン塩、ポリアクリル酸共重合体およびそのアルカ リ金属塩またはアミン塩、ポリメタクリル酸およびその アルカリ金属塩またはアミン塩、ポリメタクリル酸共重 合体およびそのアルカリ金属塩またはアミン塩、ポリア クリルアミドおよびその共重合体、ポリヒドロキシエチ ルアクリレート、ポリビニルピロリドン及びその共重合 体、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルメチルエー テル/無水マレイン酸共重合体、ポリー2-アクリルア ミドー2-メチルー1-プロパンスルホン酸及びそのア ルカリ金属塩またはアミン塩、ポリー2-アクリルアミ 10 ドー2-メチルー1-プロパンスルホン酸共重合体およ びそのアルカリ金属塩あるいはアミン塩、アラビアガ ム、繊維素誘導体(例えば、カルボキシメチルセルロー ズ、カルボキシエチルセルローズ、メチルセルローズ 等) およびその変性体、ホワイトデキストリン、プルラ ン、酵素分解エーテル化デキストリン等を挙げることが できる。また、目的に応じて、これらの樹脂を二種以上 混合して用いることもできる。

【0076】また、オーバーコート層には、前記の水溶性光熱変換剤を添加しても良い。さらに、オーバーコー 20 ト層には塗布の均一性を確保する目的で、水溶液を塗布の場合には、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルエーテルなどの非イオン系界面形性剣を添加するとどができる。オーバーコート層の乾燥塗布層は、0.1~2.0g/m゚が好ましい。それより少ないと、指紋付着汚れを起こし、それより多いと、機し現像性が悪くなる。

[0077] (支持体) 本契門の平版印刷版用限版において前記感熱層を塗布可能な朝水性支持体として大力でいた。 (例えば、ボリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等) がラミネートされた紙、金属板 (例えば、アルミーウム、亜鉛、鋼等)、プラスチックフィルム (例えば、アルミーウム、亜鉛、鋼等)、プラスチックフィルム (例えば、アルミーウム、一角板をルロース、プロピオン酸セルロース、高酸セルロース、路酸をルロース、開酸セルロース、開酸セルロース、開酸セルロース、ボリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエーアセタール等)、上記の如き金属がラミネート若しくは装着された紙又はブラスチックフィルムデルア・ルスはアルミニウム板が挙げられる。

【0079】支持体に使用し得るアルミニウム材質に関 50 等が知られている。

する公知技術を以下に列挙する。

(18)

(1) JIS 1050材に関しては、下記の技術が開示されている。

特開昭59-153861号、特開昭61-51395、特開昭62-146694、特開昭60-215726、特開昭60-215726、特開昭60-215727、特開昭60-215728、特開昭61-272357、特開昭60-215728、特開昭58-42493、特開昭58-21254、特別年4-254545、特開平4-254545、特開平4-165041、特公平1-4754545、特開平4-165041、特公平1-47545, 特開平35910、特公平55-28874号等、知られている。

【0080】(2) JIS 1070材に関しては、下 記の技術が開示されている。

特開平7-81264、特開平7-305133、特開 平8-49034、特開平8-73974、特開平8-108659、特開平8-92679号など。

【0081】(3) A1-Mg系合金に関しては、下記の技術が開示されている。

特公昭 62 - 50 8 0、特公昭 63 - 60 8 2 3、特公平3 - 61 7 5 3、特開昭 60 - 20 3 4 9 6、特開昭 60 - 20 3 4 9 6、特開昭 60 - 20 3 4 9 6、特開昭 60 - 20 3 4 9 7、特公平3 - 11 6 3 5、特開昭 61 - 2 7 4 9 9 3、特開昭 62 - 4 7 3 4 8、特開昭 63 - 4 7 3 4 8、特開昭 63 - 4 7 3 4 8、特開昭 63 - 1 3 5 2 9 4、特開昭 63 - 8 7 2 8 8、特公平4 - 7 3 3 9 2、特公平4 - 7 10 0 8 4 4、特開昭 62 - 1 4 1 9 8 5 6、特公平4 - 7 3 3 9 4、特開昭 62 - 1 4 1 9 1、特公平6 - 3 7 1 1 6 号など。また、特閒平 2 - 2 1 5 5 9 9、特閒昭 61 - 2 0 1 7 4 7 号等も知られている。

【0082】(4) A1-Mn系合金に関しては、下記の技術が開示されている。

特開昭60-230951、特開平1-306288、 特開平2-293189号など。また、特公昭54-4 2284、特公平4-19290、特公平4-1929 1、特公平4-19292、特開昭61-35995、 特開昭64-51992、US5009722、US5 028276、特開平4-226394等も知られてい

(5) A I - Mn - Mg系合金に関しては、下記の技術が開示されている。

特開昭62-86143、特開平3-222796、特 公昭63-60824、特開昭60-63346、特開 昭60-63347、EP223737、特開平1-2 83350、US4818300、BR1222777 35

【0083】(6) A I - Z r 系合金に関して、下記の 技術が知られている。

特公昭63-15978、特開昭61-51395、特 開昭63-143234、特開昭63-143235等 が知られている。

(7) A 1-Mg-Si系合金に関しては、BR1421710等が知られている。

(10084) また、支持体用アルミニウム板の製造方法としては、下記の内容が使用できる。前述のような含有 成分反び、会成が割合のアルミニウム合金高級を常法 10に従い清浄化処理を施し、鋳造する。清浄化処理には、溶腸中の水素などの不要なガスを除去するために、フラックス処理、A 「ガス、C」ガス等を使った脱オス処理や、セラミックチューブフィルタ、セラミックフォームフィルタ等のいわゆるリジッドメディアフィルターや、アルミナールク、アルミナール等を使ったフィルタリング、あらいは、脱ガスとフィルタリングを組み合わせた処理が行われる。これもの海洋や化処理は、活謝中の、非金属が住物、酸化物等の異物による欠陥、溶漏にとけ 20込んだガスによる欠陥を防ぐために、実施されることが望ましい。

【0085] 溶湯のフィルタリングに関しては、特開平6-57342、特開平3-162530、特開平5-140659、特開平4-231425、特開平4-276031、特開平5-311261、特開平6-136466時が知られている。溶湯の脱ガスに関しては、特開平5-51659、特開平7-40017号などが知られている。以上のように、清停化理を施された溶剤を使って、調造を行う。鋳造方法に関しては、連続療法に代表される。固定鋳型を用いる方法と、連続療法に代表される。固定鋳型を用いる方法と、連続療法に代表される。固定鋳型を用いる方法と、連続療法に代表される。固定対立度は、一300℃/秒の範囲で凝固される。1℃/秒未満であると、粗大な金属間化合物が参数形成される。

【0086】連続鋳造法には、ハンター法、3 C法に代表される、冷却ロールを用いた方法、ハズレー法、アルスイネキスター川型に代表される冷却ベルト、冷却プロックを用いた方法が、工業的に行われている。連続鋳 40 造法を用いた場合の冷却速度は、100~1000℃/砂の範囲で超過される。一般的に、D C 鋳造法に比べて、冷却速度が速いため、アルミマトリックスに対する、合金成分の固溶度を高くできる特徴がある。連続鋳造法に関しては、本願発明者らによって、特問率3−79798、特開平5−201166、特開平6−122949、特開平6−210406、特開平6−122949、特開平6−210406、特開平6−26230

【0087】DC鋳造を行った場合、板厚300~80 50 で、油量は3mg/m²以上で100mg/m²以下、望

0 mmの鋳塊が製造できる。その鋳塊は、常法に従い、 面削を行われ、表層の1~30mm、望ましくは、1~ 10mmを切削される。その後、必要に応じて、均熱化 処理が行われる。均熱化処理を行う場合、金属間化合物 が粗大化してしまわないように、450~620℃で1 時間以上、48時間以下の熱処理が施される。1時間よ り短い場合は、均熱化処理の効果が不十分となる。次い で、熱間圧延、冷間圧延を行って、アルミニウム圧延板 とする。熱間圧延の開始温度としては、350~500 ℃の範囲とする。冷間圧延の前、または後、またはその 途中において中間焼鈍処理を施しても良い。この場合の 中間焼鈍条件は、バッチ式焼鈍炉を用いて280℃~6 0.0℃で2~2.0時間、望ましくは、3.5.0~5.00℃ で2~10時間加熱する方法や、連続焼鈍炉を用いて4 00~600℃で360秒以下、望ましくは、450~ 550℃で120秒以下の加熱処理が採用できる。連続 焼鈍炉を使って、10℃/秒以上の昇温速度で加熱する と、結晶組織を細かくすることもできる。

【0088】以上の工程によって、所定の厚さ0.1~ 0.5mmに仕上げられた A1 板は平面性を改善するために、ローラレベラ、テンションレベラ等の矯正装置によって、平面性を改善しても良い。平面性の改善は、をシート状にカットした後に行っても良いが、生産性を向上させるためには、連続したコイルの状態で、平面性 改善を行うことが望ましい。また、板巾を所定の中に加工するため、スリッタの大を書すことが通常行われる。スリッタによって切られた板の端面は、スリッタスに切られるときに、せん新面と破断面の片方、あるいは両方が生じる。

図の18分割 版の厚みの精度は、コイル全長にわたって、±10 μ m 以内、望ましくは±6 μ m 以内が良い。また、幅方向の板厚差は6 μ m 以内 望ましくは3 μ μ m 以内がよい。また、板幅の前度は、±1.0 m m 以内がよい。また、板幅の前度は、±1.0 m 以内、望ましくは±0.5 m m 以内が望ましい。A 1 板の表面租度は、圧延ロールの表面阻さの影響を受けやすいが、最終的に中心線表面阻さ(R a)で、R a = 0.1 ~
1.0 μ m 程度に仕上げるのがよい。R a が大きすぎると、平版印刷版用としての租面に処理、燃熱層塗布をしたとき、A 1 のもともとの思さすなわち、圧延ロールによって転写された間い圧延条痕が感熱層の上から見えるため、外観上好ましくない。R a = 0.1 μ m 以下の相は、圧延ロールの表面を過度に低用度に低用度に仕上げる必要が有るため、工業に望ましくない。

【0090】また、A1板同士の摩擦によるキズの発生を防止するために、A1板の表面に、確い抽膜をもうけても良い。油膜には、必要に応じて、揮発性のものが適宜用いられる。油量が多すぎると、製造ライン中でスリップ故障が発生するが、油量が皆無だとコイル輸送中にキズが発生する不具合が生じるの

37

ましい上限は50mg/m²以下、更に望ましくは10mg/m²以下が良い。冷間圧延に関しては、特開平6-210308号等が開示されている。

【009】連続鯖造を行った場合、例えば、ハンター 法等の冷却ロールを用いると板厚1~10 mmの鋳造板 を直接連携熱治圧延でき、熱間圧延の工程を省略できる メリットが得られる。また、ハズレー法等の冷却ロール を用いると、板厚10~50 mmの鋳造板が鋳造でき、 一般的に、鋳造直後に熱間圧延ロールを配置し連続的に 圧延することで、板厚1~10 mmの連続鋳造圧延板が 10 待られる。これらの連続鋳造圧延板は、D0 強変の場合 に説明したのと同じように、冷間圧延、中間焼鈍、平面 性改善、スリット等の工程を経て0.1~0.5 mmの 板輝に仕上げられる。連続競造注を用いが着の中間焼 鈍条件、冷間圧延条件については、特開平6-2205 93、特開平6-210308、特開平7-5411 、特開平6-210308、特開平7-5411

[0092]上記方法で製造した A 1 板は表面に粗面化 処理等の表面処理を行い、感熱層を塗布して平版印刷版 用原版とすることができる。粗面化処理には、機械的粗 面化、化学的粗面化、電気化学的粗面化が単独又は組み 合わせて行われる。また、表面のキズ付き難さを確保す るための陽極酸化処理を行ったり、親水性を増すための 処理を行うことも好ましい。

[0093]以下に支持株の表面処理について説明する。アルミニウム板を相面化するに先立ち、必要に応じ、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われてもよい。アルカリの場合、次いで酸性溶液で中和、スマット除去などの処理を行ってもよい。

【0094】次いで支持体と感熱層の密着性を良好に し、かつ非画像部に保水性を与えるため、支持体の表面 を知面化する、いわゆる、砂目立て処理がなされてい る。この砂目立て処理法の具体的手段としては、サンド ブラスト、ボールグレイン、ワイヤーグレイン、ナイロ ンブラシと研磨材/水スラリーによるブラシグレイン、 研磨材/水スラリーを表面に高圧で吹き付けるホーニン ググレインなどによる機械的砂目立て方法があり、また アルカリまたは酸あるいはそれらの混合物からなるエッ チング剤で表面を粗面化処理する化学的砂目立て方法が 40 ある。また英国特許第896、563号公報、特開昭5 3-67507号公報、特開昭54-146234号公 報及び特公昭48-28123号公報に記載されている 電気化学的砂目立て方法、または特開昭53-1232 0.4号公報、特開昭54-63902号公報に記載され ている機械的砂目立て方法と電気化学的砂目立て方法と を組み合わせた方法、特開昭56-55261号公報に 記載されている機械的砂目立て方法と鉱酸のアルミニウ ム塩の飽和水溶液による化学的砂目立て方法とを組み合

状体を接着剤またはその効果を有する方法で接着させて 表面を粗面化する方法や、微細な凹凸を有する連続帯や ロールを支持体材料に圧着させて凹凸を転写することに よって粗面を形成させてもよい。

【0095】これらのようた粗面化方法は複数を組み合わせて行ってもよく、その順序、繰り返し数などは任意に選択することができる。複数の知面化処理を均一に行えるようにするために酸またはアルカリ水溶液による化学の処理を行っとができる。上記、酸またばアルカリ水溶液による化・ドリウム、ケイ酸ナトリウム、炭のでは、例えばフッ酸、フッ化ジルコン酸、リン酸、硫酸、性酸などの酸および水酸化アルカリ水溶液が挙げられる。これらの酸またはアルカリ水溶液はそれぞれ一種または二種以上を混合して使用り水高液はそれぞれ一種または二種以上を混合して使用することができる。化学的処理はこれらの酸またはアルカリの0.05~40重量%水溶液を用い、40℃~100℃の液温において5~300秒処理するのが一般的である。

20 【0096】 前述のような相面化処理すなわち砂目立て 処理して得られた支持体の表面には、スマットが生成し ているので、このスマットを除去するために適宜水洗あ るいはアルカリエッチング等の処理を行うことが一般的 に好ましい。このような処理としては、例えば特公昭4 8-28123号公報に記載されているアルカリエッチ ング法や特別昭53-12739号公報に記載されている硫酸デスマット法等の処理方法が挙げられる。本党の に用いられるアルミーウよ支持体の場合には、前述のよ うな前処理を施した後、通常、耐摩耗性、耐薬品性、保 の 水性を向上させるために、陽極酸化によって支持体に被 化皮膚を形成させる。

【0097】アルミーウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては多孔質酸化度類を形成するものならばいかなるものでも使用するとができ、一般は伝統酸、リン酸、シュウ酸、クロム酸を50いはこれらの温酸が用いられる。それらの電解質の速度は電解質の種類によって適宜決めも30で一概に特定し得ないが、一般的には影解質の濃度が1~80%溶液、液温は5~70℃、電流密度5~60 A/dm³、電圧1~100 V、電解

3 電流密度 > 60 A / d m 、電圧 1 ~ 10 0 V、電解時間 10 8b ~ 5分の電阻にあれば強当である。陽極酸化皮膜の量は 1.0 g / m 「以上が好適であるが、より好ましくは2.0 ~ 6.0 g / m 「の範囲である。陽極酸化皮膜が1.0 g / m 「未達であると診開がが不十分であったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、印刷刷は、傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。

記載されている機械が89自立て方法と鉱機のアルミニウ ム塩の総和水溶液による化学的砂目立て方法とを組み合 わせた方法と知られている。また上記支持体材料に、粒 50 回りにより、裏面にも0.01~3g/m の陽極酸化

39 皮膜が形成されるのが一般的である。また、アルカリ水 溶液 (例えば数%の苛性ソーダ水溶液) や、熔融塩中で の陽極酸化処理や、例えばホウ酸アンモン水溶液を用い た無孔性陽極酸化皮膜を形成させる陽極酸化処理なども 行うことができる。陽極酸化処理を行う前に、特開平4 -148991号や特開平4-97896号に記載され ている水和酸化皮膜生成を行ってもよく、また、特開昭 63-56497号や特開昭63-67295号に記載 されている金属ケイ酸塩溶液中での処理、水和酸化皮膜 牛成処理や、特開昭 5 6 - 1 4 4 1 9 5号に記載されて 10 いる化成皮膜生成処理などを行うこともできる。

【0099】本発明の平版印刷版用原版に用いられるア ルミニウム支持体は、陽極酸化処理後に有機酸もしくは その塩による処理、または該有機酸もしくはその塩を感 熱層塗布の下塗り層として用いることができる。有機酸 またはその塩としては、有機カルポン酸、有機ホスホン 酸、有機スルホン酸またはその塩等が挙げられるが、好 ましくは有機カルボン酸またはその塩である。有機カル ボン酸としては、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、ラ ウリン酸、パルミチン酸、ステアリン酸等の脂肪族モノ 20 カルボン酸類;オレイン酸、リノール酸等の不飽和脂肪 族モノカルボン酸類;シュウ酸、コハク酸、アジピン 酸、マレイン酸等の脂肪族ジカルボン酸類;乳酸、グル コン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸等のオキシカルボ ン酸類;安息香酸、マンデル酸、サリチル酸、フタル酸 等の芳香族カルボン酸類および Ia、IIb、IIIb、IVa、VI bおよびVIII族の金属塩およびアンモニウム塩が挙げら れる。上記有機カルボン酸塩のうち好ましいのは蟻酸、 酢酸、酪酸、プロピオン酸、ラウリン酸、オレイン酸、 コハケ酸および安息香酸の上記金属塩およびアンモニウ 30 ム塩である。これらの化合物は単独でも2種以上組み合 わせて用いてもよい。

【0 1 0 0 】 これらの化合物は水、アルコールに 0.0 01~10重量%、特に0.01~1.0重量%の濃度 となるよう溶解されるのが好ましく、処理条件としては 25~95℃、好ましくは50~95℃の温度範囲、p Hは1~13、好ましくは2~10分、10秒~20 分、好ましくは10秒~3分間支持体を浸漬するか、処 理滅を支持体に途布する。

【0101】また、さらに陽極酸化処理後、以下のよう な化合物溶液による処理や、これらの化合物を、感熱層 途布の下塗り層として用いることができる。好適に用い られる化合物としては、例えば、置換基を有してもよい フェニルホスホン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホ スホン酸、ゲリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸 およびエチレンジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置 換基を有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、 アルキルリン酸およびグリセロリン酸などの有機リン 酸、置換基を有してもよいフェニルホスフィン酸、ナフ ロホスフィン酸などの有機ホスフィン酸、グリシン、B アラニン、バリン、セリン、スレオニン、アスパラギ ン酸、ガルタミン酸、アルギニン、リジン、トリプトフ ァン、パラヒドロキシフェニルグリシン、ジヒドロキシ エチルグリシン、アントラニル酸等のアミノ酸;スルフ ァミン酸、シクロヘキシルスルファミン酸等のアミノス ルホン酸: 1-アミノメチルホスホン酸、1-ジメチル アミノエチルホスホン酸、2-アミノエチルホスホン 酸、2-アミノプロピルホスホン酸、4-アミノフェニ ルホスホン酸、1-アミノエタン-1, 1-ジホスホン 酸、1-アミノ-1-フェニルメタン-1、1-ジホス ホン酸、1-ジメチルアミノエタン-1、1-ジホスホ ン酸、1-ジメチルアミノブタン-1、1-ジホスホン 酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸等のア ミノホスホン酸等の化合物が挙げられる。 【0102】また、塩酸、硫酸、硝酸、スルホン酸(メ

タンスルホン酸等) またはシュウ酸と、アルカリ金属、 アンモニア、低級アルカノールアミン(トリエタノール アミン等)、低級アルキルアミン(トリエチルアミン 等) 等との塩も好適に使用することができる。

【0103】ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンイミンおよび その鉱酸塩、ポリ (メタ) アクリル酸およびその金属 塩、ポリスチレンスルホン酸およびその金属塩、(メ タ) アクリル酸アルキルエステルと2-アクリルアミド 2 - メチルー1 - プロパンスルホン酸およびその金属 塩、塩化トリアルキルアンモニムメチルスチレンのポリ マーおよびその(メタ)アクリル酸とのコポリマー、ポ リビニルホスホン酸等の水溶性ポリマーも好適に使用す ることができる。さらに可溶性デンプン、カルボキシメ チルセルロース、デキストリン、ヒドロキシエチルセル ロース、アラビアガム、グアーガム、アルギン酸ソー ダ、ゼラチン、グルコース、ソルビトールなども好適に 使用することができる。これらの化合物は単独でも2種 以上を組み合わせて用いてもよい。

【0 1 0 4】 処理の場合、これらの化合物は水かつ/ま たはメチルアルコールに 0.001~10重量%、特に 0.01~1.0重量%の濃度となるよう溶解されるの が好ましく、処理条件としては25~95℃、好ましく は50~95℃の温度範囲、pHは1~13、好ましく は2~10、10秒~20分、好ましくは10秒~3分 間支持体を浸漬する。

【0105】感熱層塗布の下塗り層として用いる場合 は、同様に水かつ/またはメチルアルコールに0.00 1~10重量%、特に0.01~1.0重量%の濃度と なるように溶解され、必要に応じて、アンモニア、トリ エチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質や、塩 酸、リン酸などの酸性物質によりpHを調節し、pHI ~12の範囲で使用することもできる。また、平版印刷 チルホスフィン酸、アルキルホスフィン酸およびグリセ 50 版用原版の調子再現性改良のために黄色系染料を添加す

ることもできる。有機下途圏の乾燥後の被覆量は、2~ 200mg/m²が適当であり、好ましくは5~100 mg/m²である。上記の被覆数2のg/m²未満であ ると汚れ防止等の本来の目的に十分な効果が得られな い。また、200mg/m²を越えると顧嗣力が低下す る。

41

 $[0\ 1]$ 6.] なお支持体と感熱層との密葉性を高めるための中間層を設けてもよい。密着性の向上のためには、かの地間に、ジアン樹間が、例えばアルミュウムに吸着するリン酸化合物等からなっている。中間層の厚さは任意であり、露光した時に、上層の感光層と均一な結合形成反応を行い得る原みではければならない。通常、乾燥固体で約1~ $100\,\mathrm{mg/m}^2$ の塗布割合がよく、 $5\sim4\,\mathrm{cmg/m}^2$ がである。中間層中におけるシアン樹脂の使用割合は、 $30\sim100\,\mathrm{mg/m}^2$ がましくは $60\sim1100\,\mathrm{mg/m}^2$

【○107】以上のような処理及び下途り層付与の前 に、陽極酸化処理された支持体は、水洗処理されたあ と、 理像液や湿し水への陽極酸化皮膜の溶解抑制、 感熱 層成分の残膜抑制、陽極酸化皮膜強度向上、陽極酸化皮 20 膜の親水性向上、感熱層との密着性向上等を目的に、以 下のような処理を行うことができる。そのひとつとして は、陽極酸化皮膜をアルカリ金属のケイ酸塩水溶液と接 触させて処理するシリケート処理が挙げられる。この場 合、アルカリ金属ケイ酸塩の濃度は0.1~30重量 %. 好ましくは0. 5~15重量%であり、25℃での pHが10~13.5である水溶液に5~80℃、好ま しくは10~70℃、より好ましくは15~50℃で 0.5~120秒間接触させる。接触させる方法は、浸 せきでもスプレーによる吹き付けでも、いかなる方法に 30 よってもかまわない。アルカリ金属ケイ酸塩水溶液はp 日が10より低いと演はゲル化し、13、5より高いと 陽極酸化皮膜が溶解されてしまう。

【0108】本発明に用いられるアルカリ金属ケイ酸塩 は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウ ムなどが使用される。アルカリ金属ケイ酸塩水溶液のp H調整に使用される水酸化物としては、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどがある。な お、上記処理液にはアルカリ土類金属塩もしくは第IVb 族金属塩を配合してもよい。アルカリ土類金属塩として は、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸マグネ シウム、硝酸バリウムのような硝酸塩や、硫酸塩、塩酸 塩、リン酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩、ホウ酸塩などの水 溶性塩が挙げられる。第IVb族金属塩としては、四塩化 チタン、三塩化チタン、フッ化チタンカリウム、シュウ 酸チタンカリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、塩化 酸化ジルコニウムなどが挙げられる。アルカリ土類金属 もしくは第IVb族金属塩は単独または2種以上組み合わ せて使用する事ができる。これらの金属塩の好ましい節 囲は、0.01~10重量%であり、更に好ましくは

0.05~5.0重量%である。

【0109】他には、各種封孔処理も挙げられ、一般的 に陽極酸化皮膜の封孔処理方法として知られている、水 蒸気封孔、沸騰水(熱水)封孔、金属塩封孔(クロム酸 塩/重クロム酸塩封孔、酢酸ニッケル封孔など)、油脂 含浸封孔、合成樹脂封孔、低温封孔(赤血塩やアルカリ +類塩などによる)などを用いる事ができるが、印刷版 用支持体としての性能(感熱層との密着性や親水性)、 高速処理、低コスト、低公害性等の面から水蒸気封孔が 比較的好ましい。その方法としては、たとえば特開平4 176690号公報にも開示されている加圧または常 圧の水蒸気を連続または非連続的に、相対湿度70%以 上・蒸気温度95℃以上で2秒~180秒程度陽極酸化 皮膜に接触させる方法などが挙げられる。他の封孔処理 法としては、支持体を80~100°

配度の熱水または アルカリ水溶液に浸漬または吹き付け処理する方法や、 これに代えるか或いは引き続き、亜硝酸溶液で浸漬また は吹き付け処理することができる。亜硝酸塩の例として は、周期律表のIa、IIa 、IIb 、IIIb、IVb 、IVa 、VI a、VIIa、VIII族の金属の亜硝酸塩またはアンモニウム 塩、すなわち亜硝酸アンモニウムが挙げられ、その金属 塩としては、例えばLiOz、NaNOz、KNOz、M g (NO₂)₂, Ca (NO₂)₂, Zn (NO₃)₂, AI (NOz) s, Zr (NOz) e, Sn (NOz) s, Cr (NO2) a, Co (NO2) a, Mn (NO2) a, Ni (NO₂) 2等が好ましく、特にアルカリ金属亜硝酸塩が 好ましい。亜硝酸塩は2種以併用することもできる。 【0110】処理条件は、支持体の状態及びアルカリ金 属の種類により異なるので一義的には決定できないが、 例えば亜硝酸ナトリウムを用いた場合には、濃度は一般 的には0.001~10重量%、より好ましくは0.0 1~2重量%、浴温度は一般的には室温から約100℃ 前後、より好ましくは60~90℃、処理時間は一般的 には15~300秒、より好ましくは10~180秒の それぞれの範囲から選択すればよい。亜硝酸水溶液のロ Hは8.0~11.0に調製されていることが好まし く、8、5~9、5に調製されていることが特に好まし い。亜硝酸水溶液のpHを上記の範囲に調製するには、 例えばアルカリ緩衝液等を用いて好適に調製することが できる。該アルカリ緩衝液としては、限定はされないが 例えば炭酸水素ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合水 溶液、炭酸ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合水溶 海 炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムの混合水溶 液、塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合水溶液、 塩酸と炭酸ナトリウムの混合水溶液、四ホウ酸ナトリウ ムと水酸化ナトリウムの混合水溶液等を好適に用いるこ とができる。また、上記アルカリ緩衝液はナトリウム以 外のアルカリ金属塩、例えばカリウム塩等も用いること ができる。

【0111】以上のような、シリケート処理または封孔

処理を施したあと、感熱層との密着性をアップさせるた めに特開平5-278362号公報に開示されている酸 性水溶液処理と親水性下塗りを行うことや、特開平4-282637号公報や特開平7-314937号公報に 開示されている有機層を設けてもよい。

【0112】支持体表面に以上のような処理或いは、下 塗りなどが施された後、支持体の裏面には、必要に応じ てバックコートが設けられる。かかるバックコートとし ては特開平5-45885号公報記載の有機高分子化合 物および特開平6-35174号記載の有機または無機 10 金属化合物を加水分解および重縮合させて得られる金属 酸化物からなる被覆層が好ましく用いられる。これらの 被覆層のうち、Si (OCH₁)₁、Si (OC

2 H₂) 4、S 1 (OC3 H₇) 4、S 1 (OC4 H₉) 4 など のケイ素のアルコキシ化合物が安価で入手し易く、それ から得られる金属酸化物の被覆層が耐現像液に優れてお り特に好ましい。

【0113】平版印刷版用支持体として好ましい特性と しては、中心線平均粗さで0. 10~1. 2 μmであ る。0. 10 µmより低いと感熱層と密着性が低下し、 著しい耐刷の低下を生じてしまう。1.2 μmより大き い場合、印刷時の汚れ性が悪化してしまう。さらに支持 体の色濃度としては、反射濃度値として0.15~0. 65であり、0.15より白い場合、画像露光時のハレ ーションが強すぎ画像形成に支障をきたしてしまい、 65より黒い場合、現像後の検版作業において画像 が見難く、著しく検版性が悪いものとなってしまう。

【0114】なお、本発明の平版印刷版用原版は、その 支持体として、粗面化処理を行なった後陽極酸化処理を 行なったアルミニウム基板を用いることにより、より良 30 好な機ト現像性を得ることができる。その場合、さらに シリケート処理を行なったアルミニウム基板を用いるこ とが、より好ましい。

【0115】本印刷版はアルミニウム基板上に水に不溶 な親水性層あるいはレーザー露光により発熱しかつ水に 不溶な親水性である層、あるいはアルミニウム基板上に 断熱性を持たせるために有機ポリマーよりなる断熱層を 設けたうえに、水に不溶な親水性層あるいはレーザー露 光により発熱しかつ水に不溶な親水性である層を設けて もよい。例えば、アルミニウム基板上にシリカ微粒子と 40 親水性樹脂の親水性層を設けてよい。さらにこの親水性 層内に先に挙げた光熱変換材料を導入し、発熱性親水性 層としてもよい。このようにすることでアルミニウム基 板に熱が逃げ難くなるのみか、レーザー露光により発熱 する親水性基板として用いることができる。更にこの親 水性層とアルミニウム基板の間に有機ポリマーからなる 中間層を設けると、より一層熱がアルミ基板に逃げるこ とを抑制することができる。支持体としては、機上現像 性の観点から、多孔質でないものが良く、また親水性有 機高分子材料を40%以上含むような水により膨潤する 50 パノール、ブタノール、エチレングリコールモノメチル

ような支持体はインクが払われ難く問題となってしま

【0116】本発明に使用される親水層は3次元架橋し ており、水及び/又はインキを使用する平版印刷で、浸 し水に溶けない層であり、下記のコロイドからなること が望ましい。ベリリウム、マグネシウム、アルミニウ ム、ケイ素、チタン、硼素、ゲルマニウム、スズ、ジル コニウム、鉄、バナジウム、アンチモン又は遷移金属の 酸化物又は水酸化物のゾルゲル変換系からなるコロイド である。場合によってはこれらの元素の複合体からなる コロイドであっても良い。これらのコロイドは、上記の 元素が酸素原子を介して網目状構造を形成すると同時に 未結合の水酸基やアルコキシキ基を有していて、これら が混在した構造となっている。活性なアルコキシ基や水 酸基が多い初期加水分解縮合段階から、反応が進行する につれ粒子径は大きくなり不活性になる。コロイドの粒 子は一般的には2nmから500nmで、シリカの場合 5 nmから100nmの球形のものが本発明では好適で ある。アルミニウムのコロイドのように100×10n mのような羽毛状のものも有効である。更には、10n mから50nmの球状粒子が50nmから400nmの 長さに連なったパールネック状のコロイドも用いること ができる。

【0117】コロイドはそのもの単独で用いてもよく、 更には親水性の樹脂と混合して用いることも可能であ る。また、架橋を促進させるために、コロイドの架橋剤 を添加しても良い。通常、コロイドは安定剤によって安 定化されている場合が多い。カチオンに荷電しているコ ロイドではアニオン基を有する化合物、逆にアニオンに 荷電しているコロイドではカチオン基を有する化合物が 安定剤として添加されている。たとえば、ケイ素のコロ イドではアニオンに荷雷しているので、安定剤としてア ミン系の化合物が添加され、アルミニウムのコロイドで はカチオンに荷電しているので、塩酸や酢酸等の強酸が 添加されている。この様なコロイドを基板上に塗布する と、常温で透明な皮膜を形成するものが多いが、コロイ ドの溶媒が蒸発しただけではゲル化は不完全で、安定剤 を除去できる温度に加熱することによって、強固な3次 架橋を行い、本発明に好ましい親水層となる。

【0118】上記のような安定化剤を用いずに、出発物 質(例えば、ジ、トリ及び/又はテトラアルコキシシラ ン)から直接加水分解縮合反応を行わせ、適当なゾル状 熊を作りだしそのまま基板上に塗布し、乾燥させ反応を 完了させても良い。この場合、安定化剤を含む場合より も低温で三次元架橋させることができる。

【0119】この他、適当な加水分解縮合反応物を有機 溶媒に分散安定化させたコロイドも本発明には好適であ る。溶媒が蒸発するだけで、三次元架橋した皮膜が得ら れる。これらの溶媒にはメタノール、エタノール、プロ 45

エーテル、エチレングリコールモノエチルーエテルやメ チルエチルケトンのような低沸点の溶媒を選択すると、 常温での乾燥が可能となる。とくに本発明では、メタノ ールやエタノール溶媒のコロイドが低温での硬化が容易 であり有用である。

【0120】上記のコロイドと共に用いる親水性樹脂と しては、例えばヒドロキシル、カルボキシル、ヒドロキ シエチル、ヒドロキシプロピル、アミノ、アミノエチ ル、アミノプロピル、カルボキシメチルなどの親水基を 有するものが好ましい。具体的な親水性樹脂として、ア ラビアゴム、カゼイン、ゼラチン、澱粉誘導体、カルボ キシメチルセルロース及びそれらのNa塩、セルロースア ヤテート、アルギン酸ナトリウム、酢酸ビニルーマレイ ン酸コポリマー類、スチレン-マレイン酸コポリマー 類、ポリアクリル酸類及びそれらの塩、ポリメタクリル 酸類及びそれらの塩、ヒドロキシエチルメタクリレート のホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシエチルアク リレートのホモポリマー及びコポリマー、ヒドロキシブ ロピルメタクリレートのホモポリマー及びコポリマー、 ヒドロキシプロピルアクリレートのホモポリマー及びコ 20 ポリマー、ヒドロキシブチルメタクリレートのホモポリ マー及びコポリマー、ヒドロキシブチルアクリレートの ホモポリマー及びコポリマー、ポリエチレングリコール 類、ヒドロキシプロピレンポリマー類、ポリビニルアル コール類、ならびに加水分解度が少なくとも60重量 %、好ましくは少なくとも80重量%の加水分解ポリビ ニルアセテート、ポリビニルホルマール、ポリビニルブ チラール、ポリビニルピロリドン、アクリルアミドのホ モポリマー及びコポリマー、メタクリルアミドのホモポ リマー及びポリマー、N-メチロールアクリルアミドの 30 ホモポリマー及びコポリマー、2-アクリルアミド-2 メチルプロパンスルホン酸あるいはその塩のホモポリ マー及びコポリマー等を挙げることができる。

【0121】特に好ましい親水性樹脂は水溶性でない水 酸基含有ポリマーで、具体的には、ヒドロキシエチルメ タクリレートのホモポリマー及びコポリマーとヒドロキ シエチルアクリレートのコポリマーである。これらの親 水性樹脂はコロイドと共に用いられるが、その添加割合 は親水性樹脂が水溶性の場合、親水層の全固形分の40 重量%以下が好ましく、水溶性でない親水性樹脂の場合 40 は全固形分の20重量%以下が好ましい。

【0122】これらの親水性樹脂はそのまま用いること もできるが、印刷時の耐刷力を増加さる目的で、コロイ ド以外の親水性樹脂の架橋剤を添加してもよい。この様 な親水性樹脂の架橋剤としては、ホルムアルデヒド、グ リオキザール、ポリイソシアネート及びテトラアルコキ シシランの初期加水分解・縮合物、ジメチロール尿素や ヘキサメチロールメラミンを挙げることができる。本発 明の親水層には上記の酸化物又は水酸化物のコロイドと 親水性樹脂以外に、コロイドの架橋を促進する架橋剤を 50 にインクを供給して印刷を開始する方法、(2) 印刷版

添加してもよい。その様な架橋剤としてはテトラアルコ キシシランの初期加水分解縮合物、トリアルコキシシリ ルプロピルーN. N. Nートリアルキルアンモニウムハ ライドあるいはアミノプロピルトリアルコキシシランが 好ましい。その添加割合は親水層の全固形分の5重量% 以下であることが好ましい。

【0123】更に本発明の親水層には、感熱感度を高め るために親水性の光熱変換材料を添加してもよい。特に 好ましい光熱変換材料は水溶性の赤外線吸収染料で、前 10 記の式(I)のスルホン酸基やスルフォン酸のアルカリ 金属塩基あるいはアミン塩基を有するシアニン染料であ る。これらの染料の添加割合は親水層の全量に対し、1 重量%~20重量%で、更に好ましくは5重量%~15 重量%である。

【0124】本発明の三次元架橋した親水層の塗布厚み は $0.1\mu m$ から $10\mu m$ であることが好ましい。より 好ましくは、0. 5 μmから 5 μmである。薄すぎる と、親水層の耐久性が劣り、印刷時の耐刷力が劣る。ま た厚すぎると、解像度が低下する。以後、有機ポリマー よりなる中間層について述べる。中間層に用いることの できる有機ポリマーはポリウレタン樹脂、ポリエステル 樹脂、アクリル樹脂、クレゾール樹脂、レゾール樹脂、 ポリビニルアセタール樹脂、ビニル樹脂など通常使用さ れる有機ポリマーであれば問題なく使用することができ る。これらは 0. lg/m²~5. 0g/m²の塗布量で あることが好ましい。0.1g/m2以下だと断熱効果 が小さく、5.0g/ m^2 より大きいと非画像部の耐刷 性が劣化する。

【0125】本発明の平版印刷版用原版は高出力のレー ザー露光により、画像形成することができるが、サーマ ルヘッドのような書込み機を用いてもよい。特に本発明 では赤外または近赤外領域で発光するレーザーを用いる ことが好ましい。特に近赤外領域で発光するレーザーダ イオードが特に好ましい。なお、この場合、その感熱層 に含まれるマイクロカプセルの外壁が破れるエネルギー 量で行う必要がある。また、紫外線ランプによる記録も 可能であるが、本発明においては、波長760nmから 1200nmの赤外線を放射する固体レーザ及び半導体 レーザにより画像露光されることが好ましい。レーザの 出力は100mW以上が好ましく、露光時間を短縮する ため、マルチビームレーザデバイスを用いることが好ま しい。また、1 画素あたりの露光時間は20 μ秒以内で あることが好ましい。記録材料に照射されるエネルギー は $10\sim300$ m l/c m であることが好ましい。 【0126】このようにして露光されたプレートは処理 することなく、印刷機のシリンダーに取り付けられる。 このようにして取り付けられたプレートは以下のような 手順で印刷することができる。

(1) 印刷版に湿し水を供給し、機上で現像した後に更

に湿し水およびインクを供給し、機上で現像した後に印刷を開始する方法、(3) インクを販に供給し、湿し水 を供給すると同時に紙を供給し印刷を開始する方法など がある。またこれらのブレートは特許第2938398 号に記載されているように、印刷機シリンダー上に取り 付けた後に、印刷機に搭載されたレーザーにより露光 し、その後に選し水及び/またはインクをつけて機上現 像することも可能であり、好ましくは水又は水溶液によって現像専可能な、あるいは現像することもしたそのまま 印刷機に接着し用刺することが可能なものである。

47

[0127]

【実施例】以下、実施例をもって本発明を説明するが、 本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。 実施例1~6、比較例1~3

実施の1~3、比較の1~3 支持体(1)の作成(アルミーウム基板の作成) 99.5%以上のアルミニウムと、Fe 0.30%、 S10.10%、T10.02%、Cu 0.013% を含むJIS A1050合金の溶湯を清浄化処理を施 し、跡道した。清浄化処理には、溶湯中の水素などの不 繋なガスを除去するために脱ガス処理し、サラミックチ 20 ューブフィルケ処理を行った。鋳造法はDC鋳造法で行 った。緩固した板厚500mmの鋳塊を表面から10mm 面削し、金原間化合物が担大化してしまわないように 550℃で10時間均質化処理を行った。次いで、40 0℃で熱間圧延し、連続焼髪炉中で500℃60秒中間 焼剣した後、毎低圧延を行って、板厚0.30mmのア ルミニウム圧延板とした。圧延ロールの阻さを制御する ことにより、冷間圧延後の中心終平均失重阻とれるを 0.2 mに計劃した。その後、平面性を直とせるた

【0128】次に平版印刷版支持体とするための表面処理を行った。まず、アルミニウム板表面の圧極油を除去するため10%アルミン酸ソーダ水溶液で50℃30秒間脱脂処理を行い、30%硫酸水溶液で50℃30秒間中和、スマット除去処理を行った。

めにテンションレベラーにかけた。

【0129】次いで支持体と感熱層の密着性を良好にし、かつ非画像部に保水性を与えるため、支持体の表面を粗面化する。いわゆる、砂目立て処理を行った。1%の硝酸と0.5%の硝酸アルこを含有する水溶液を45℃に保ち、アルミウェブを水溶液中に流しながら、間接40給電セルにより電流密度20A/dm、デューティー比1:10交審液形でアノード側電気量240C/dmがを与ることで電解炉目立てを行った。その後10%アルミン酸ソーダ水溶液で50℃30秒間エッチング処理を行い、30%硫酸水溶液で50℃30秒間エッチング処理を行い、30%硫酸水溶液で50℃30秒間本のスマット除去例単を行った。「アルミニウム排極A)

【0130】さらに耐摩耗性、耐薬品性、保水性を向上 させるために、陽極酸化によって支持体に酸化皮膜を形 成させた。電解質として硫酸20%水溶液を35℃で用 い、アルミウェブを電解質中に通搬しながら、間接給電 50

セルにより $14A/dm^2$ の直流で電解処理を行うことで $2.5g/m^2$ の陽極酸化皮膜を作成した。(アルミニウム基板 B)

この後印刷版非面像部としての親水性を確保するため、 シリケート処理を行った。処理は3号珪酸ソーダ1.5 %水溶液を70℃に保予ルミウェブの接触時間が15 秒となるよう通搬し、さらに水洗した。Siの付着量は 10mg/m²であった。以上により作成した支持体の Ra(中心線表面阻さ)は0.25µmであった。(ア 10 ルミニウム基板C)

【0131】支持体(2)の作成(アルミ基板上に発熱 性親水性層を設けた支持体の作成)

メタノール 2 4 0 gにメタノールシリカゾル (日産化学 (株) 製: $10 \, \text{nm} \sim 20 \, \text{nm}$ のシリカ粒子を3 0 重髪 % 含有するメタノール溶液からなるコロイド) 4 5.2 g、ポリ2 ーヒドロキシエチルメタウリレート1.5 2 g、赤外線吸収染料 (1-32) 3.2 gを溶解し、先に得られたアルミニウム基板 C上にパー塗布を行った。オープンを用いて100 g 3 0 秒の条件で乾燥させた。塗布量は1.0 g/ 12 であった。

【0132】支持体(3)の作成(アルミ基板上に断熱性層を設け更に発熱性親水層を設けた支持体の作成) 断熱性層の塗布

メチルエチルケトン100g、乳酸メチル90gにポリピニルブチラール樹脂10gを溶解し、先に得られたアルミニウム基板C上にパー塗布を行った。オーブンを用い100度、1分の条件で乾燥した。塗布量は0.5g/miであった。

発熱性親水性層の塗布

30 メタノール240gにメタノールシリカゾル45.2 g、ボリ2-ヒドロキシエチルメタクリレート1.52 g、赤外独映収染料(1-32)3.2gを冷解し、大に得られた断熱層上にバー塗布を行った。オーブンを用いて100度30秒の条件で乾燥させた。塗布量は1.0g/1°であった。

【0133】マイクロカプセルの合成

低りは3.3 ドインカンにかの過度(1) 油相成分としてキシレンジイソシアネート40g、トリメチロールプロバンジアクリレート10g、アリルメタ クリレートとブチルメタクリレートの主体(モル比60/40)パイオニンA41C(竹本油脂製)10gを簡繁エチル60gに溶解した。水相成分としてPVA205(クラレ製)の4%水溶器(20gを作成した。油相成分および水相成分をホモジナイザーを用いて10000rpmで乳化した。その後、水を40g添加し、空温で30分さらに40度で3時間機搾した。このようにして得られたマイクロカブセが図の形が透度は20%であり、平均和発化し、5μmであった。

【0134】熱で外壁が破れるマイクロカプセルの合成

(2

油相成分としてイソホロンジイソシアネート30g、へ キサメチレンジイソシアネート10g、ジエチレングリ コールジグリシジルエーテル20g、パイオニンA41 C (竹本油脂製) 0. 1 gを酢酸エチル60gに溶解し た。水相成分としてPVA205 (クラレ製) の4%水 溶液 1 2 0 g を作成した。油相成分および水相成分をホ モジナイザーを用いて10000г pmで乳化した。そ の後、水を40g添加し、室温で30分さらに40度で 3時間攪拌した。このようにして得られたマイクロカプ セル液の固形分濃度は2.0%であり、平均粒径は0.7 10 以上のように作成した支持体(1)、(2)、(3)上 リョであった。

49

【0135】熱により合体する微粒子状ポリマーの合成 (1) (比較例) (反応基を持たない) スチレン15g、ポリオキシエチレンフェノール水溶液

(濃度9. 84×10°mol・1') 200mlを加* 感熱層塗布液組成

水 1-メトキシー2-プロパノール 合成したマイクロカプセル(1)、(2)、 熱により合体する微粒子状ポリマー(1) (固形分換算で)

ポリヒドロキシエチルアクリレート p - ジアゾフェニルアミンの硫酸塩 赤外線吸収染料(1-32)

【0138】以上の液をバー塗布した後、オープンで9 0度120秒の条件で乾燥した。塗布量は0.5g/m² であった。このようにして得られた機上現像可能な平版 印刷版を、水冷式40W赤外線半導体レーザを搭載した Creo計製Trendsetter 3244VFS にて、出力9W、外面ドラム回転数210rpm、版面 30 エネルギー100mJ/cm²、解像度2400dpi の条件で露光した後、処理することなく、印刷機ハイデ ルSOR-Mのシリンダーに取付け、湿し水を供給した のち、インキを供給し、さらに紙を供給し印刷を行っ た。すべてのプレートについて問題なく機上現像するこ とができ印刷可能であった。各プレートで得られた印刷 物の枚数を表-1に記載した。

[0139]

【表1】

表-1				
	支持体	燃熱層	印刷可能な枚数	
実施例 1	(1)	マイクロカプセル(1)	9000枚	
実施例 2	(2)	マイクロカブセル(1)	12000 枚	
実施例 3	(3)	マイクロカブセル(1)	20000枚	
実施例 4	(1)	マイクロカブセル(2)	7000枚	
実施例 5	(2)	マイクロカプセル(2)	12000枚	
実施例 6	(3)	マイクロカブセル(2)	15000 枚	
比較例 1	(1)	微粒子状ポリマー(1)	1000枚	
比較例 2	(2)	微粒子状ポリマー(1)	1500 枚	
比較例 3	(3)	微粒子状ポリマー(1)	1800 枚	

* え、250 г р m でかき混ぜながら、系内を窒素ガスで 置換する。この液を25℃にした後、セリウム(IV)ア ンモニウム塩水溶液 (濃度 O. 984×10° mol・ 1 1 10m1添加する。この際、硝酸アンモニウム水 溶液 (濃度58.8×10 mol·1) を加え、p H1. 3~1. 4に調整する。その後8時間これを攪拌 した。このようにして得られた液の固形分濃度は9.5 %であり、平均粒径は 0. 4 μmであった。

【0136】感熱層の塗布

に、合成例(1)、(2)のマイクロカプセルおよび合 成例(1)の熱により合体する微粒子状ポリマーをそれ ぞれ含有する以下の組成よりなる塗布液を作成し、感熱 層の塗布を行った。

[0137]

70 g 30 0.5g

0.3g

0.30 ※【0140】以上の結果から、マイクロカプセルを感熱 層に有する平版印刷版の方が耐刷性について良好である ことが分かった。またアルミニウム基板上に発熱性親水 層を設けた支持体、あるいはアルミ基板上に断熱性層を 設け重にその上に登熱性親水層を設けた支持体の方が耐 刷性について良好となることが分かった。レーザー照射

時に熱で外壁が破れるマイクロカプセル(1) および (2) は、熱により合体する微粒子状ポリマー(1)よ りも低エネルギー露光時に耐刷性が高いことが分かっ

【0141】 事施例7

支持体(3)の上に下記よりなる、感熱性層塗布液を塗 布した。

[0142]

70 g 1-メトキシー2-プロパノール 30

40

(27) 特開2001-277740 51 52 合成したマイクロカプセル (1) 5 g (()所分換算で)	1
51 52 合成したマイクロカブセル(1) 5 g	
合成したマイクロカプセル(1) 5 g	
ポリアクリル酸 0.5g	
(重量平均分子量 25000)	
ソルビトールトリアクリレート 1.0g	
赤外線吸収染料 (I-31) 0.3g	
t - プチルジフェニルヨードニウムの硫酸塩 0.3g	
【0143】このようにして得られたプレートを、マル *印刷を行うことができた。	
チチャンネルレーザヘッドを搭載した富士写真フイルム 【0144】実施例8	
(株) 製Luxel T-9000CTPにて、ビーム 10 支持体(3)の上に下記よりなる、感熱性層塗布液を塗	È
1本当たりの出力250mW、外面ドラム回転数800 布した。	
r p m、解像度 2 4 0 0 d p i の条件で露光した。実施 【0 1 4 5】	
例1~6と同様に印刷したところ15000枚の正常な*	
7k 7 0 g	
1-メトキシー2-プロパノール 30 g	
マイクロカプセル (2) 5 g	
(固形分換算で)	
ポリアクリル酸(重量平均分子量 25000) 0.5 g	
ジェチレントリアミン 1.0g	
赤外線吸収染料(I-31) 0.3 g	
t ープチルジフェニルヨードニウムの硫酸塩 0.3 g	
【0146】このようにして得られたプレートを、マル ※び水相成分をホモジナイザーを用いて10000rpm	
チチャンネルレーザヘッドを搭載した富士写真フイルム で乳化した。その後水を40g添加し、室温で30分さ	
(株)製Luxel T-9000CTPにて、ビーム 5に40℃で3時間撹拌した。このようにして得られた 1本当たりの出力250mW、外面ドラム回転数800 マイクロカプセル液の固形分濃度は20%であり、平均	
	7
r p m、解像度 2 4 0 0 d p i の条件で露光した。実施 粒径は0.6 μ m であった。 例 1 ~ 6 と同様に印刷したところ3 0 0 0 0 枚の正常な 【0 1 4 9】熱で外壁が破れるマイクロカブセルの合成	.17
例1~6と同様に印刷したところ30000枚の正常な 【0149】 熱で外壁が取れるマイクロガブでから古り 印刷を行うことができた。 (4)	X.
【0 1 4 7】実施例 9 ~ 1 1 油相成分としてキシレンジイソシナナエート 4 0 g、	L.
下記マイクロカプセル (3) および (4) を合成し、前 30 リメチロールプロパンジアクリレート9g、アリルメ	
記支持体(1)の上に下記よりなる感熱性層塗布液を塗 クリレートとブチルアクリレートの共重合体8g(モ)	
布した以外は、実施例1~6と同様に、平版印刷版用原 比60/40)赤外線吸収染料(1-33)3g、パー	
版の作成、画像露光、印刷を行った。 オニンA41C(竹本油脂性) 0.1g、2,2'-ア	
【0148】熱で外壁が破れるマイクロカプセルの合成 ゾビスイソブチロニトリル1.0gを酢酸エチル60」	
(3) に溶解した。水相成分としては P V A 2 O 5 (クラレ	
油相成分としてキシレンジイソシナナエート40g、ト 製)の4%水溶液120gを作成した。油相成分および	
リメチロールプロパンジアクリレート9g、アリルメタ 水相成分をホモジナイザーを用いて10000rpm	C
クリレートとブチルアクリレートの共重合体8g(モル 乳化した。その後水を40g添加し、室温で30分さ	5
比60/40) 赤外線吸収染料 (I-33) 3g、パイ に40℃で3時間撹拌した。このようにして得られた~	₹
オニンA41C(竹本油脂性)0.1gを酢酸エチル6 40 イクロカプセル液の固形分濃度は20%であり、平均	拉
0 gに溶解した。水相成分としては $PVA205$ (クラ 径は 0 . 6 μ mであった。	
レ製)の4%水溶液120gを作成した。油相成分およ※ 【0150】	
実施例9の感熱性層塗布液	
水 7 0 g	
1-メトキシー2-プロパノール 30 g	
合成したマイクロカプセル (3) 5 g	
ポリヒドロキシエチルアクリレート 0.5g	
p — ジアゾジフェニルアミン硫酸塩 0.3 g	

54

7.0

30 g 5

7.0 g

3.0 g

> 5 g

0.5g

0.3g

g

0.5g

0.3e

0. 1 g

53 лk

1-メトキシー2-プロパノール 合成したマイクロカプセル(3)

ポリヒドロキシエチルアクリレート

パラジアゾジフェニルアミン硫酸塩 赤外線吸収染料(1-32)

[0152]

実施例11の感熱性層塗布液

7k

1-メトキシー2-プロパノール 合成したマイクロカプセル(4) ポリヒドロキシエチルアクリレート パラジアゾジフェニルアミン硫酸塩

赤外線吸収染料(1-32)

【0153】実施例9、10における印刷可能枚数はい ずれも15000枚であり、実施例11における印刷可 能枚数は25000枚であり、マイクロカプセル内に光

熱変換物質を含まない実施例1 (9000枚) に比べ高 耐刷性を示し、さらに反応を開始促進する化合物をマイ

クロカプセル内に入れることでさらなる高耐刷性を示し 20 た。

【0154】実施例12~14

前記支持体(1)の作成工程によって得られるアルミニ ウム基板 A~Cを用いた以外は、実施例1と同様に、平 版印刷版用原版の作成、画像露光、印刷を行い、その機 上現像性を評価した。なお、機上現像性は、印刷開始か ら100枚目の印刷物における150線/インチの網点 のシャドー部が、何%まで再現できるかを観察し、その 値が高いほど良好なものとした。結果を下記表-2に示 す。

[0155]

[表2]

表-2 印刷時の汚れ難さ

	アルミニウム基板	シャドー部の再現性(%)
実施例12	アルミニウム基板 A	90
実施例13	アルミニウム基板 B	95
実施例14	アルミニウム基板 C	98

0.1g * 【0156】上記表-2より、支持体として、陽極酸化 処理、さらにはシリケート処理を行ったアルミニウム基 板を用いた方が、機上現像性に優れていることが解っ t-

[0157]

【発明の効果】 本発明の平版印刷版用原版は、親水性支 持体上に設ける感熱層中に、画像形成に用いる熱で外壁 が破れ、かつその熱により反応する官能基を有する化合 物を含有しているマイクロカプセルを含有させることに より、高感度日つ高耐刷性で残色、汚れのない印刷物を 与えることが可能であり、さらに良好な機上現像性を示 し、かつ、より多くの印刷物を得ることができたもので ある。また、支持体として、陽極酸化処理、さらにはシ リケート処理を行ったアルミニウム基板を用いることに より、より良好な機上現像性を示すことができた。

30

フロントページの続き

(51) Int. Ct. 2 識別記号 FΙ √
√
フ
フ
ー
ド
(
参
考
) C O 3 F 7/09 G 0 3 F 7/09 7/11 7/117/26 521 7/26521

F ターム(参考) 280025 AAO1 AA12 AB03 ACO8 AD01 BC13 BC42 8800 BJ03 CC11 DA10 DA36 BA40 FA10 28096 AA06 BA01 CA03 EA04 FA23 28111 A AO4 AA24 BA01 BA10 BA03 DA05 BA08 BA11 BA34 DA43 BA44 DA66 DA50 DA51 DA52 BA33 BA55 BA60 DA74 BA75 EA01 EA03 EA05 FA18

GA05 GA09